

令和7年3月17日

会員各位

公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 宮本 恭幸

第2回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、第2回次世代リソグラフィ技術研究会の定例会につきまして、ご案内をさせていただきます。今回もオンライン定例会になりますので、事前登録の必要はございません。当日お時間になりましたら、下記へ直接アクセスしてください。追記に注意事項を記載いたしましたので、ご確認ください。

また、出来るだけ多くの方に参加していただきたく、法人会員の方は社内での回覧も併せてお願いいたします。

敬具

記

- 開催日時： 令和7年4月2日(水) 定例会：13:00-16:05
- 開催場所： オンライン定例会 (Zoom でのライブ配信)
- 参加費： 会員無料
- プログラム：

13:00~13:05	『開会の挨拶』 東京科学大学 宮本 恭幸氏
13:05~13:35	『SPIE Advanced Lithography + Patterning 2025 全体報告』 ALITECS 岡崎 信次氏
13:35~14:20	『Optical and EUV Nanolithography XXXVIII』 ASML Japan 永原 誠司氏
14:20~14:50	『Advances in Patterning Materials and Processes XLII』 大阪大学 古澤 孝弘氏
14:50~15:05	休憩
15:05~15:35	『Metrology, Inspection, and Process Control XXXIX』 日立製作所 備前 大輔氏
15:35~16:05	『Novel Patterning Technologies 2025』 キヤノン 伊藤 俊樹氏

以上

- 追記：・録画や録音は禁止させていただきます。
- ・発表者以外はミュートをお願いいたします。
 - ・参加者を明らかにするため、ログイン名を所属+名前に変更ください。
#参加者リストで自分の名前にマウスを合わせ「詳細」をクリックすると
#名前を変更できます。

また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願いいたします。

事務局：公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ）好美
TEL（携帯）：090-5403-1147
E-mail：ngl@jsap.or.jp